# 高温還元したRh/CeO2の自発的酸化による*n*-ブタンの酸化的改質反応の常温駆動

佐藤勝俊<sup>a, b</sup>・福田渉<sup>a</sup>・中鋪勝太<sup>a</sup>・永岡勝俊<sup>a</sup>・西口宏泰<sup>a</sup>・瀧田祐作<sup>a</sup> <sup>a</sup>大分大学工学部 〒870-1192 大分県 大分市 大字旦野原700番地 <sup>b</sup>日本学術振興会 特別研究員(DC)

Oxidative reforming of *n*-butane triggered from ambient temperature by oxidation of Rh/CeO<sub>2</sub> reduced at high temperature

Katsutoshi Sato<sup>a, b</sup>, Sho Fukuda<sup>a</sup>, Syota Nakashiki<sup>a</sup>, Katsutoshi Nagaoka<sup>a</sup>, Hiroyasu Nishiguchi<sup>a</sup> and Yusaku Takita<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Engineering, Oita University 700 Dannoharu, Oita 870-1192

<sup>b</sup> Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Oxidative reforming of *n*-butane is triggered rapidly and repeatedly on reduced CeO<sub>2</sub> supported Rh catalysts from ambient temperature without heating the catalyst externally. The auto ignition is enabled by the heat produced by spontaneous oxidation of the catalytic support, i.e., CeO<sub>2-x</sub> to CeO<sub>2</sub>. The highly localized heat produced by oxidation of CeO<sub>2-x</sub> starts combustion and subsequent reforming of *n*-butane.

Key words: Hydrogen production, Oxidative reforming, Ambient temperature, Rh/CeO2

#### 1. 緒 言

水素は究極のクリーンエネルギー媒体である。このた め燃料電池や水素エンジンを中心とする水素社会の構築 が環境問題の解決の切り札として期待されている[1]。ま た、水素社会の早期構築のために水素製造法の確立が求 められており、関連技術の研究が盛んに行われている。 家庭用電源や自動車に搭載される燃料電池は起動と停止 を頻繁に繰り返すという特徴がある[2]。したがって、シ ステムに改質器を内蔵し、炭化水素の改質によって水素 を供給する場合、特に起動時にはシステムの起動後短時 間で水素を生成出来る起動性に優れた改質システムが必 要である。炭化水素の酸化的改質反応(OR)は発熱(燃焼) 反応と吸熱(改質)反応を組み合わせた反応であり、一旦 反応が駆動すると、十分な水素生成速度を得ることが可 能な温度(>873 K)まで触媒層が自己加熱されるという水 蒸気改質反応(SR)にはない特徴を持つ。また、反応開始 温度がSRよりも低い上、効率的にも優れている[3]。しか し、ORであっても反応の駆動には473 K以上の触媒層温 2008年10月27日受理

度を必要とする。これを達成するためには外部からのエ ネルギー供給と昇温のための時間が不可欠であり、起動 時間の短縮と操作の簡便化を妨げる最大の原因となって いた。ORの急速起動に関してはこれまでにも幾つかの研 究が行われているが[45]、筆者らは、高温でH2還元処理 したRh/CeO2を触媒として用いることで、mC4H10のOR を常温から瞬間的に駆動させることが可能である事を見 出した。本反応は起動が非常に高速であるため短時間で 安定してH2の製造が可能になる事、駆動時、定常運転時 共に外部からの熱供給を一切必要としないことが大きな 特長である。筆者らは、本反応が前述の問題を解決する 手法として非常に有望であると考えている。本報では Rh/CeO2による反応の駆動特性やその駆動メカニズムに ついて検討した結果について報告する。

#### 2. 実験

触媒は硝酸Rh水溶液と、Air流通下で1073 K、5hの予 備焼成を行ったCeO2(触媒学会参照触媒 JRC-CEO3)から 含浸法によりRhを担持し、Air流通下で723K、5h焼成 したものを用いた。尚、金属の担持量は1wt%とした。

活性測定は固定床流通式反応装置内で行った。200 mg の触媒を石英製反応管に充填し、Fig. 1に示す手順で実 験を行った。まず、1073 Kで1 hのH2還元を行った後に、 反応管をArでパージした。この際、触媒上の吸着H2を除 くため同温度で30 min保持した後、反応開始温度(323 K) まで冷却した。その後、触媒層の温度が安定するのを待 ってORガスを触媒層に供給したが、反応中は電気炉によ る外部からの熱供給を一切行わない状態にした。また、 反応ガスについては以下の化学量論式を想定し、組成を  $nC_4H_{10}/O_J/Ar/N_2 = 1/2/11/1 (167 Lh<sup>-1</sup>·g·)と決定した。$ 

 $n^{-}C_{4}H_{10} + 2O_{2} \rightarrow 4CO + 5H_{2} \Delta H(323 \text{ K}) = -316 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 

反応ガス分析にはGC-TCD(Agilent technologies 6890N GC system)とオンラインで接続したQ-Mass(ANELVA M-201QA-TDM)を用いた。転化率および生成物の収率の 定義式は文末にまとめた。またこの時、触媒層入り口付 近に挿入した熱電対(o.d.=1.5 mm)により、触媒層内の 温度変化をモニターした。

触媒のキャラクタリゼーションとして還元処理後に触 媒が常温付近で吸収するO2の量を測定するため、1073 K で1h、H2還元した後に323 Kと723 Kでパルス法による O2吸収量測定を行った。また、H2/Ar=1/19の混合ガス流 通下、1073 KでのXRDパターン測定を*in situ*条件で行い (PANalytical XPert PRO MPD)、還元処理が触媒構造に与 える影響について検討した。



**Fig. 1.** Sequence for activity test of n-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> OR from ambient temperature.

#### 3. 結果と考察

#### 3.1 反応駆動初期の活性挙動

1073 Kで還元したRh/CeO2を用いて323 KでORの反応 駆動実験を行った。Fig. 2 (A)に駆動時における生成ガス の挙動をMassにより分析した結果を示す。反応ガスを供 給すると触媒層内部温度の急激な上昇と共にH2濃度が 増大し、323 Kという低温でORが駆動された。その際、 MSによる分析からは混合ガスの供給開始直後から生成 ガスが検出され始め、反応が瞬時に駆動していることが 明らかとなった。そのため、触媒層内部の熱電対は24 s 後に790 Kを指示したが、これには熱電対の応答性の影 響が含まれており、実際にはさらに短時間で触媒層の温 度は上昇したものと推察している。また、H2生成速度は 反応開始後15 s以内に定常値のおよそ80%にあたる32 Lh<sup>.1</sup>g<sup>1</sup>に到達しており、数分後には定常活性である40.1 Lh<sup>.1</sup>g<sup>1</sup>に達した。このことは本反応では駆動後短時間で 安定したH2の製造が可能である事を示している。また、



**Fig. 2.** Formation rate of products *vs.* time on stream over 1wt% Rh/CeO<sub>2-x</sub> in OR.

活性測定中電気炉による加熱は行っておらず、反応は外部からの熱供給を必要とすることなく進行した。Fig. 2 (B)は反応開始後極初期の挙動を拡大したものである。反応極初期にはCOとCO2の生成速度がH2生成速度を上回っていたが、その後にH2の生成速度が急激に増加し、CO、CO2の生成速度を上回っていた。このことはCO、CO2の生成に続いてH2生成が起こったこと、つまり燃焼反応に続いて改質反応が進行したことを示している。

#### 3.2 反応駆動のメカニズムに関する考察

既に述べた様に、酸化的改質反応の駆動には貴金属触 媒を用いたとしても473 K以上の触媒層温度を必要とす る。即ち、Rh/CeO2において混合ガスの供給直後に反応 が駆動したということは、触媒層が混合ガスとの接触に よって酸化的改質反応の駆動可能温度まで急激に昇温し た事を示唆している。そこで温度上昇の原因を調べるた め以下の実験を行った。

まず、Rh/CeO<sub>2</sub>に反応実験と同じ1073 K、1hのH<sub>2</sub>還元 を行い、その後O<sub>2</sub>とArの混合ガスを供給して触媒層の温 度変化を測定した(Fig. 3)。その結果、触媒層の温度は12 s 後に477 Kまで上昇し、その後徐々に下降した。これに より、触媒層自身の発熱が反応の駆動力となっているこ とが明らかとなった。次に、パルス法により還元処理後 の触媒が323 Kで吸収するO<sub>2</sub>の量を測定したところ、888 µmol·g<sup>1</sup>という非常に多量のO<sub>2</sub>を吸収していることが分 かった。これは、計算上Rh<sup>0</sup>が完全に酸化された場合に 吸収されるO<sub>2</sub>の量(73 µmol·g<sup>1</sup>)を大幅に上回る値である。 このとき、RhがRh<sub>2</sub>O<sub>3</sub>まで完全に酸化されたと仮定する



**Fig. 3.** Catalyst bed temperature *vs.* time on stream over reduced 1wt% Rh/CeO<sub>2</sub> under  $O_2$ /Ar flow at 323 K following reduction.

と、 $CeO_{2x}$ の組成は $CeO_{17}$ と計算された。即ち、1073 Kでの還元処理によってRhだけではなく担体である $CeO_2$ も還元されていることが示唆された。

そこで、Rh/CeO2中の還元相(CeO2x)の存在を確認する ために*in situ* XRD測定を行った(Fig. 4)。測定の結果、ま ず室温では立方晶蛍石構造のCeO2のみが観測された。次 に1073 KでのHy/Ar処理中にXRDパターンを測定したと ころ、同様の結晶相のみが見られ、Ce2O3やCesO11は見ら れなかった。しかし、1073 KでのAir処理中のXRDパタ ーンと比較すると、(220)回折線が20 = 0.6°ほど低角度側 にシフトしていた。また、Hy/Ar処理中、Air処理中の格 子定数はそれぞれ0.552 nm、0.545 nmであった。この様 に還元膨張に由来すると考えられる格子定数の変動が見 られたことから、還元処理によりRh/CeO2内に酸素欠陥 を含むCeO2xが形成された事が確認された。



**Fig. 4.** In situ XRD patterns of Rh/CeO<sub>2</sub> measured at 1073 K (A) in  $H_2$ /Ar flow and (B) in air flow. Right box shows a region of (220) peak.

ここで、CeO2を1673 KでH2還元することにより調製したCe2O3は、次式により空気中で自然に発火することが報告されている[6]。

Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+1/2O<sub>2</sub>→2CeO<sub>2</sub>  $\Delta$ H(323K)=-381 kJ·mol<sup>1</sup> このことから我々は、CeO<sub>2</sub>の還元によって部分的に生成 したCeO<sub>2x</sub>の自発的な酸化により熱が発生し、触媒層が 内部から加熱されることにより $mC_4H_{10}$ の燃焼とそれに 続く改質反応を駆動したものと推察した。

#### 3 Rh/CeO<sub>2</sub>による反応駆動の繰り返し

Rh/CeO2の耐久性を調べるため、ORの駆動と停止を繰り返し、活性挙動を検討した(Fig. 5)。まず1073 Kで還元

したRh/CeO<sub>2</sub>を用いて、1回目のOR反応駆動実験を行っ た。反応ガスの供給開始直後から触媒層内部温度の急激 な上昇とH2濃度の増大が観測され、ORが駆動したのが 確認された。次に、反応開始から20 min後に反応管内を Arで置換し反応を停止した。その後、1073 KでのH2還元、 Arパージ、323 Kからの反応という一連のサイクルをさ らに4回繰り返したところ、全サイクルで反応ガスを流 通すると速やかにH2が生成し、数分以内に定常活性に達 した。この時、O2は完全に消費され、mC4H10の転化率は 80%程度であった。また、反応生成物はH2、CO2、CO、 H2O、CH4であった。触媒層の温度と水素生成速度の最 大値は全サイクルでほぼ同程度であり、Rh/CeO2が反応 の繰り返し使用に耐えることの出来る高い耐久性を有し ていることが明らかとなった。



**Fig. 5.** Conversions, yields, and  $H_2$  formation rate *vs.* number of reaction cycle over 1wt% Rh/CeO<sub>2-x</sub> in OR.

### 3. 4 Rh/CeO2による長時間反応実験

Rh/CeO<sub>2</sub>の耐久性について更に検討するため、長時間 の連続実験を行った。結果をFig.6に示す。一旦反応が駆 動した後は、外部からの熱供給は一切行わずに反応を続 けたが、45 hに渡って反応は進行し続けた。このことは 反応中、発熱反応、吸熱反応、外部への熱損失の間で熱 自立が保たれていたことを示唆している。45 hの反応中、 活性の低下や生成物の組成の変動は見られなかった。ま た、反応終了後の触媒をXRDで分析したところ反応の前 後で構造に大きな変化はなく、炭素析出量もごく微量 (<0.56 wt%)であった。以上の結果より、Rh/CeO<sub>2</sub>が長時 間に渡って安定な運転が可能な非常に有望な触媒である ことが明らかとなった。



**Fig. 6.** Conversions, yields, and  $H_2$  formation rate *vs.* time on stream over 1wt% Rh/CeO<sub>2x</sub> in OR for 45 h.

#### 4. 結 言

改質器の始動後短時間で安定してH₂を生成する方法と して、*n*C₄H10のORの常温駆動を見出し、これについて 種々の検討を行った。その結果以下の知見が得られた。

 1073 Kで還元処理したRh/CeO2によってrC4H10のOR を無加熱かつ急速に駆動させることが可能であることを 見出した。

(2) 反応を常温で駆動出来るのは、還元処理によって担体 中に生成した $CeO_{2x}$ が反応ガス中の $O_2$ によって酸化され、 この際の発熱によって触媒層が急速に加熱された結果、  $nC_4H_{10}$ の燃焼反応とそれに続く改質反応が駆動される ためである。

(3) Rh/CeO2は反応駆動の繰り返しや、長時間の連続運転 にも耐え得る、優れた耐久性を持つ。また炭素析出耐性 にも優れており、非常に有望な触媒であると言える。

#### 参考文献

[1] 例えば、阿部俊明、ペテロテック、26,692-695 (2003)

- [2] Takenori Ohi, Takeshi Miyata, Dalin Li, Tetsuya Shishido, Tomonori Kawabata, Tsuneji Sano and Katsuomi Takehira, Appl. Catal. A, 308, 194 (2006)
- [3] S. Ahmed, M. Krumpelt, Int. J. Hydrogen Energy, 26, 291 (2001)
- [4] Heon Jung, Wang Lai Yoon, Hotae Lee, Jong Soo Park, Jang Sik Shin, Howon Lab, Jong Dae Lee, J. Power Sources 124, 76 (2003)
- [5] C. A. Leclerc, J. M. Redenius and L. D. Schmidt, Catal. Letters 79, 39 (2002)

[6] T. Sata, M. Yoshimura, J. Cerem. Soc. Japan (Yogyo – Kyokai -Shi) 76, 116 (1968).

## 定義式等

$$n-C_{4}H_{10} \text{ conversion } (\%) = \frac{n-C_{4}H_{10(in)} - n-C_{4}H_{10(out)} \times \theta}{n-C_{4}H_{10(in)}} \times 100$$

$$O_{2} \text{ conversion } (\%) = \frac{O_{2(in)} - O_{2(out)} \times \theta}{O_{2(in)}} \times 100$$

$$H_{2} \text{ yield } (\%) = \frac{H_{2(out)} \times \theta}{n-C_{4}H_{10(in)} \times 5} \times 100$$

$$CO \text{ yield } (\%) = \frac{CO_{(out)} \times \theta}{n-C_{4}H_{10(in)} \times 4} \times 100$$

$$CO_{3(out)} \times \theta$$

$$CO_2 \text{ yield (\%)} = \frac{CO_2(\text{out}) + O}{n - C_4 H_{10(\text{in})} \times 4} \times 100$$

$$CH_4 \text{ yield } (\%) = \frac{CH_{4(\text{out})} \times \Theta}{n \cdot C_4 H_{10(\text{in})} \times 4} \times 100$$

Dilution factor:  $\theta = \frac{N_{2(in)}}{N_{2(out)}}$